

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 17 年 8 月 11 日 (2005.8.11)

【公開番号】特開 2002-305081 (P2002-305081A)
 【公開日】平成 14 年 10 月 18 日 (2002.10.18)
 【出願番号】特願 2002-22983 (P2002-22983)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 B 33/10

C 2 3 C 14/24

H 0 5 B 33/14

【 F I 】

H 0 5 B 33/10

C 2 3 C 14/24 G

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 1 月 19 日 (2005.1.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 5 2 】

次に蒸着された基板を取り出し、赤色発光層用統合マスクが装着されている別の蒸着装置に移載し、緑色発光層の場合と同じく基板と統合マスクの位置合わせを行った後、 1×10^{-4} Pa の真空下で赤色発光層として 1 w t % の 4 - (ジシアノメチレン) - 2 - メチル - 6 (ジュロリジルスチリル) ピラン (DCJT) をドーピングした Alq3 を 15 nm 蒸着した。つづいて、基板を青色発光層用統合マスクが装着されているさらにまた別の蒸着装置に移載し、同様に基板と統合マスクの位置合わせを行った後、 1×10^{-4} Pa の真空下で青色発光層として 4 , 4 ' - ビス (2 , 2 - ジフェニルビニル) ジフェニル (DPVBi) を 20 nm 蒸着した。